PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 58-070540 (43)Date of publication of application: 27.04.1983

(51)Int.CI.

H01L 21/66 G02B 7/11 H01L 21/68 // G03B 3/00

(21)Application number: 56-168619

-168619 (7

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

23.10.1981

(72)Inventor: OSHIMA YOSHIMASA

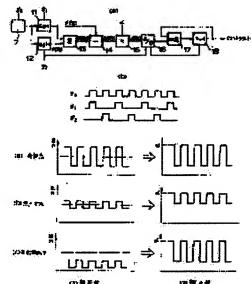
AKIYAMA NOBUYUKI HARA YASUHIKO FUSHIMI SATOSHI OSHIDA YOSHISADA

(54) FOCAL POSITION DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect focal position with high accuracy and stability for the detection of the focal position from a contrast of a reflected light obtained by projecting bright and dark light pattern onto a substance to be measured, by correcting a difference between bright and dark by the bright light pattern level.

CONSTITUTION: An array-like detector 7 is scanned by a pulse ψ 0 to output one after another. A signal level f $(\psi 1)$ in the bright and a signal level f($\psi 2$) in the dark are sampled 11, 12 by the timing of a pulse ψ 1 for the former and the timing of a pulse ψ 2 for the latter, and are subjected to subtraction 13. The difference is divided 14 by f(ψ 1) and multiplied 15 by a fixed value α to calculate the difference i(ψ 2) of the signals between bright and dark is calculated so that the bright signal level is constant α . The signal i(ψ 2) which is the difference corrected is converted 16 into a digital value, added 17 and latched 18 to obtain a contrast signal of the entire number (m) of elements of the detector 7. An



influence from a change of a reflectance is avoided by filting the detector and the projected pattern. Further, two projected pattern are provided on the vertical surfaces arranged before and behind the focal point, and the boundary of the projected patterns is disposed in the center to effect comparison. Thereby, the focally deflecting direction can be made known with a high accuracy from the value of the peak valve.

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-70540

| ⑤Int. ClH 01 LG 02 BH 01 L | 21/66 7/11 | 織別記号 | 庁内整理番号 68515 F 64182 H 66795 F | 公開 昭和58年(19 発明の数 1 審査請求 未請求 | 83) 4 月27日 |
|---|---------------|------|---|---|------------|
| // G 03 B | 3/00 | | 6418—2H | | (全 7 頁) |

9焦点位置検出装置

②特 願 昭56-168619

②出 願 昭56(1981)10月23日

②発 明 者 大島良正

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

@発 明 者 秋山伸幸

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

⑫発 明 者 原靖彦

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑩発 明 者 伏見智

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 秋本正実

最終頁に続く

明細

発明の名称 焦点位置検出要置 特許請求の範囲

1. 明部と暗部とが周期的に組合わされた光バ **メーンを半透鏡。レンズを介して被測定物体に投** 影結像せしめる第1の光学系と、前記被測定物体 からの反射光パターンを前記レンス,半避便を介 して複数の光電業子よりなるアレイ状検知器に結 像せしめる第2光学系と、アレイ状検知器により 光電変換した出力信号から光パターンに対応した 1 赦素毎の明暗パルスを得、腱明」暗パルスの信 号差により前記被制定物体の焦点位置を検出する コントラスト検出回路とを備えて成る焦点位置検 出装置であつて、前記コントラスト検出回路は、 前記アレイ状検出器の出力のうち明部の信号レベ ルをホールドする第1のホールド回路と、 明部に 続く暗部の信号レベルをサンブルホールドする無 2のサンプルホールド回路と、該第1,第2のサ ンプルホールド回路の出力差を算出する引集回路 と、該出力差を明部の信号レベルで割算し、その 結果に一定値を掛け、明部の信号レベルが一定になるように明部、暗部の信号レベル差を算出する割、乗算回路と、放割、乗算回路出力を得、補正された差分信号をデイジタル信号に変換し、アレイ素子数全体のコントラスト信号を求める A/D変換器、加算器、ラッチ回路とから成ることを特徴とする焦点位置検出装置。

2. 前記、アレイ状検知器は、マトリクス状の 平面構造であつて、かつ、該アレイ状検知器と光 パターンとを被測定物体表面上のパターンに対し て一定角度傾けて配置してあることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の焦点位置検出装置。

3. 前記、光バターンは、第1光学系の光軸近くの異なる面上に2個配置し、単一アレイ状検出器により反射光を検出して無点ずれ方向を判別するようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項に記載の無点位置検出装置。 発明の詳細な説明

本装置は LSI ウエハなどパターンが形成された 面上で自動的に焦点合せを行なう装置に関するも のである。

高集積 LSI、パブルノモリ、機像管面板等の外額検査を行なう場合、これらは 2 ~ 3 μm の数細パメーンを有するため高倍率の顕数鏡が使用される。 高倍率の顕数鏡の焦点深度は 1 μm 以下であり、外額検査を自動で行なう場合には積密な自動焦点合せ機構が要求される。

このための無点位置検出装置として、従来は、 鋭い先端を有する触針による接触型の装置、細い ノズル先端から噴出する空気の流れ抵抗から入 ル端と物体表面の間隙を求める装置、静電容量 の間隙を求める非接触型の装置等があつた。接触 型の装置では触針により試料に傷を付ける虞れが あつた。間隙を求める装置・非接触型の装置は、 類数鏡の対物レンズの他にノズルやビックアッ が必要なためスペースがないときには使用不可能 である。

以上の緒欠点を解消するため本発明者等により 第1 図に示す構成により検出する方法が提案され ている。この方法は、第2 図に示す如きの一定の

を介して光軸上に設置されたアレイ状検知器7上に結像し、そのアレイ状検知器7を構成する光電業子により操像される。ここで、光パターン3の周期とアレイ状検知器7の光電業子(アレイ業子)の閉口(大きさ)の周期とは一定の関係を有している。即ち、アレイ素子開口の周期Pに対し、パターンの周期は2Pである。 然も、パターンの暗 ひび 明部の中心はアレイ素子開口の中心と一致している。

アレイ状検知器 ? からの出力信号は、シリアルに走査することにより取り出され、コントラスト検出図路 8 により処理される。アレイ状検知器 ? の出力は、光パターン 3 の周期とアレイ業子の周期の関係により、第 3 図に示すように 1 絵景毎に明,暗がパルス的に繰り返す。

試料 6 が合焦点位置にあるとき、アレイ状検知器 7 の出力は第 3 図(a)のように明・暗の差(コントラスト)が大きいが、焦点位置からずれると、光パターンの投影像がほけるため、同図(b)のようにコントラストが低下する。コントラスト検出回

特別昭58-70540K2) 周期を有する光パターンを試料面上に投影し、投 影像のポケ具合により焦点合せを行なうものであ

第1図にかいて、光源1より放出された中色光は照明用のレンズ2を通過して第2図に示すがよく中が、 構成された光パターン部3に到達する。光光経過ーンの通過方向に対して整直へに対して変ないで、 一型とたるでは、上記白色光の通過方向に対して変ないで、 でででは、上記白色光のかに光を変がといる。 ででででは、上記白色光のかに光を変がまり、 でででででは、上記台色光のでは、 でででででは、上記台色光のでは、 でででででは、上記台色光をできないが、 でででは、上記台色光のが、 でででは、 でででは、 ででいる。 でいる。 でいる。

以上の構成の光パターンを有する光パターン部 3を通過した白色光は、半透鏡4で反射され、レンズ5に至り、光パターンが試料6の表面に投影される。次いで、そのパターン光は試料6の光学的性格に応じた反射光となりレンズ5,半透鏡4

略 8 では、明,暗の差を求め、それが最大となる ように試料 6 を上下させて無点合せを行なつてい *

この方法では

(1) 試料が LS I ウェハ等のように反射率に変化があり、かつ試料を移動させながら無点合せを行なう場合、反射率の高い箇所で無点位置検出を行なうと、アレイ状検知器 7 の出力は 第 3 図(a)のように明,暗の差が大きい。

一方、反射率の低い箇所ではアレイ状検知器 7 の出力は同図(c)のようにレベルが下がつて明・暗の差が小さくなり、反射率の高い箇所で焦点がずれている場合(同図(b))との区別がつかない。

- (2) 試料上に反射率の高いパターンが周期的に 形成されており、かつその周期が光パターン の周期に近づいてくると、アレイ状検知器 7 の出力は、明、暗のレベルが反転することが あり、正確な無点位置検出が出来ない。
- (3) 焦点位置検出を行なつても、それが合焦点

特場昭58-70540(3)

位置なのか無点ずれの位置なのか判別不可能である。そのため試料 6 を常時上下させて明、暗の差の変化を見る必要があるが試料が援動する離れがあり、試料の表面検査が高精度にできない。

というような問題点がある。

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点をなくし、試料表面の状態に影響されない高精度な焦点位置検出装置を提供するにある。

本発明は、第1図の存成に基づいて焦点位置検出を行なうものであるが、第3図に示した検波形で、明部の信号レベルを一定にするように、次の暗部の信号レベルを推正して試料表面の反射を除去するものである。マトリ、試料表の変化の影響を除去するものである。マトリ、試料を面上に形成されているペターンに対して、対して投知器を投影光ペターンとで一定角度質響を除去する。さらに、投影光ペターンを光軸垂直で、焦点位置の前後に2枚配置し、単一のすい

イ状検知器で検出して、前半分の検出信号と後半分の検出信号を比較することにより焦点のずれ方向を判別するものである。

以下、第4図~第9図に従つて本発明を静述する。

第4図(a)は反射率の影響を除去するための一実 精例である。第1図の構成例におけるアレイ状検 知器7の出力信号における、明部、暗部のレベル 差を、明部のレベルで割算することにより、その アレイ状検出器の出力信号を補正している。第5 図に出力信号の補正例を示す。明部の信号レベル が一定(a)になるように出力信号を処理する。これ により、第5図(c)に示すように反射率が変化して も、反射率が高い場合と同等なコントラストを得 ることが可能となり、焦点ずれの場合(第5図(b)) と判別が可能となる。

第4図(a) において、アレイ状検知器7は第4図 (b) に示すクロックバルス (pa) により走査され、 シリアルに信号が出力される。第1のサンプルア ンドホールド回路11は第4図(b) に示すクロックパ

ルス g, の タイミングで明部の信号レベル (f (g,))をホールドし、 第 2 のサンブルアンドホールド回路 12 は第 4 図(b) に 示す クロックベルス g, の タイミングで次の暗部の信号レベル (f (g,))をホールドする。 引算回路 13 では 両者の 慈をとり、

 $g(\varphi_1) = f(\varphi_1) - f(\varphi_1)$

を賃出する。 制算回路 14 では差分信号(g (φ₂)) を明部の信号レベル (f (φ₁))で割算し、

 $h\left(\varphi_{z}\right)=g\left(\varphi_{z}\right)/f\left(\varphi_{t}\right)=1-f\left(\varphi_{z}\right)/f\left(\varphi_{t}\right)$ を算出する。掛算回路15ではその結果に一定値 (α) を掛け、明部の信号レベルが一定 (α) になるように、明部、暗部の信号レベル差

 $i(\varphi_z) = \alpha \circ h(\varphi_z) = \alpha - \alpha \circ f(\varphi_z) / f(\varphi_1)$ を算出する。 AD 変換器 16、デイジタル加算器 17、ラッチ 18 では、アレイ状検知器 7 の素子数例全体のコンテストを算出する。 AD 変換器 16 は補正された差分信号 $(i(\varphi_z))$ をデイジタル信号 $(i'(\varphi_z))$ に変換し、デイジタル加算器 17 とラッチ 18 を用いてアレイ業子数全体のコントラスト信号

 $\sum_{i=1}^{\frac{m}{2}} i'(\varphi_2)$

を求める。これにより試料面上に反射率の変化が あつても、第5図に示したように、安定なコント ラスト波形が得られる。

今、Y 方向のアレイ素子数を ℓ 個とすると、1 回の走査で ℓ 個の検出信号が同時に得られる。第6 図では $\ell=10$ とし、取り出される信号は S_1 , S_2 ,

… 、 Sto としている。 アレイ 状検知器出力(Si ~ Sto)を加算し(Io Si)、 第 4 図に示したコントラスト算出回路で処理することにより、 コントラストが求められる。 第 6 図に示すように光くアレイ状検知器を試料パターンに対しることにより低反射率パターン 19 と高反射率パターン 19 と高反射率パターン 19 と高反射率パターン 19 とのとが Y 方向では同時に検出して加がまするため、 検出光量度は対象とする 試料により決定されるが、 例えばメモリ用 LS I では 官行パターンが大部分を占めるので45度近が妥当いので、 光パターン 3 とアレイ状検知器 7 とを試料 6 に対して 傾けた方が試料移動が容易である。

また、第7図に示すように、光パターン (3a. 3b.)を無点位置の前後に、展明光学系光軸と直角平面上に、互いに交差することなく、かつ投影パターンが連続するように配置することにより、 焦点ずれ方向の判別容易で高精度なものとなる。

分信号数は m/4 である。 従つてカウンタ21 が、 クロックパルス st を m/4 個計数したとき ラッチ 18 の内容をメモリ22 化移し、同時にラッチ 18 の内 容をクリアする。また m/2 個計数したとき ラッチ 18 の内容をメモリ23 に移す。これによりメモリ22 には前半分のコントラスト

$$\left\{\begin{array}{c} m / 4 \\ \sum_{\varphi_2 = 1} i'(\varphi_2) \end{array}\right\}$$

が、メモリ23には後半分のコントラスト

$$\left\{\begin{array}{c} m/2 \\ \Sigma \\ \varphi_2 = m/4 + 1 \end{array} i'(\varphi_2)\right\}$$

がメモリされる。そして、比較回路24で両メモリ 内容を比較すれば、試料を移動させる方向がわか り、両者が等しくなるまで移動させることにより 自動焦点が可能となる。

例えば、本装置を前述の如く L8 I ウェハの外観 検査に用いる場合、パターン光が試料面上に投影 されるため、検査の邪魔になるが、無点位置検出 のためのパターン光をウェハの検査範囲外に投影 特励昭58-70540(4)

すなわち、第7図に示すように、アレイ状検知器7を光パターン3mと3bの境界が中央になるように配置すると、アレイ状検知器7の出力としては、第8図に示すように得られ、前半分mと後半分bのコントラストを比較することにより、その波高値から焦点ずれ方向を高精度に判別できる。

第9図は上記した無点ずれ方向を判別するための同路例である。第4図と同様に補正した明・暗信号レベル芸 (i(デュ))を求め、前半分のコントラストと後半分のコントラストを求め、両者を比較して試料の移動方向を決定する。

類 9 図にかいて、デイジタル加算器 17 と ラッチ 18 を用い、 AD 変換器 16 でデイ ジタルに変換された差分信号 i' (ψz) を加算し、 その内容をメモリ 22. 23 に記憶する。 カウンタ 21 はクロックパルス (ψz) を計数し、 前半分の加算が終了したとき及び 後半分の加算が終了したときにラッチ 18 の内容をメモリ 22 、 23 に記憶させ、 同時にラッチ 18 をクリアする。 アレイ状検知器 7 の X 方向の 業子数を π とすると、 全体の差分信号数は π/2 であり、半分の差

することにより、解決できる。または、検査は可 視光で行ない、本発明の焦点位量検出には赤外光 を用いて、波長分離することによつても解決でき

上述の実施例からも明らかなように本発明によれば、明部、暗部より成る光パターンを被測定物体上に投影し、得た反射光のコントラストにより焦点位置を検出する際、明都の光パターンレベルで、明、暗光パターンの差を補正することによつて被測定物体の状態に影響されない高精度で安定な焦点位置検出が達成できる。

図面の簡単な説明

第1 図は本発明の対象となる無点位置検出装置の概略構成図、第2 図は第1 図の光パターン部の構成図、第3 図(a)~(e)は第1 図にかける検出パルス波形図、第4 図(a)は本発明の一実施例を示す回路プロック図、第4 図(b)はその動作説明をするタイムチャート、第5 図(a)~(e)は第4 図(a)の回路にかける特性図、第6 図はアレイ状検知器の構成を示す図、第7 図は本発明により光パターンを2 個

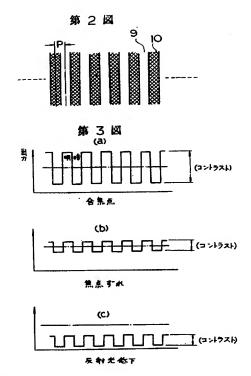
特國電58- 70540(5)

設置した場合の無点位置検出装置の概略構成図、 第8図は第7図の装置における特性図、第9図は 第7図の装置における無点位置ずれの方向を判別 するための回路ブロック図である。

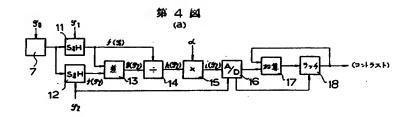
1 … 光源、 2 , 5 … レンズ、 3 , 3a , 3b … 光パターン、 4 … 半透便、 6 … 試料 (被測定物体)、 7 … アレイ状検知器、 8 … コントラスト検出回路、 9 … 光通通部、 10 … 光速へい部、 11 , 12 … サンブルアンドホールド回路、 13 … 引算回路、 14 … 割算回路、 15 … 掛算回路、 16 … A/D 変換器、17 … 加算器、 18 … ラッチ回路、 19 … 低反射率パターン、 20 … 高反射率パターン、 21 … カウンタ、 22 , 23 … メモリ、 24 … 比較回路、 25 … O R 回路。

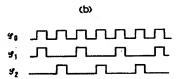
代理人弁理士 秋 本 正 実

第 1 図 8 7 7

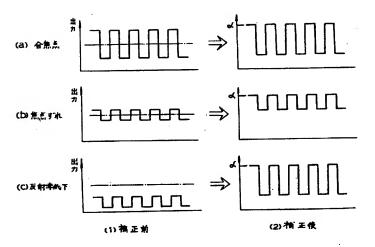


特開昭58- 70540(6)



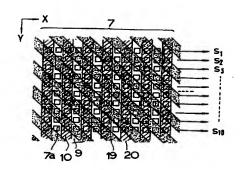


第5図

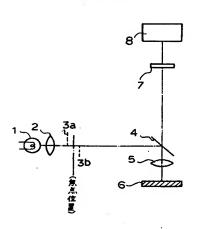


特別昭58-70540(プ)

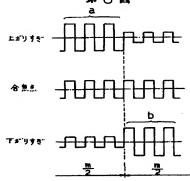
第6凶



第フ図



88



第1頁の続き

⑫発 明 者 押田良忠

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

第9図

